

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和1年6月6日(2019.6.6)

【公開番号】特開2017-191202(P2017-191202A)

【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)

【年通号数】公開・登録公報2017-040

【出願番号】特願2016-80324(P2016-80324)

【国際特許分類】

G 02 F 1/155 (2006.01)

G 02 F 1/15 (2019.01)

G 02 F 1/19 (2019.01)

【F I】

G 02 F 1/155

G 02 F 1/15 5 0 5

G 02 F 1/19

【手続補正書】

【提出日】平成31年4月10日(2019.4.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

対向配置される第1および第2の基板と、

前記第1の基板の、前記第2の基板との対向面に配置される第1の電極であって、表面上に一体的に形成された凸凹構造を含む第1の電極と、

前記第2の基板の、前記第1の基板との対向面に配置される第2の電極と、

前記第1および第2の基板の間隙に、銀を含むエレクトロデポジション材料を含有する電解質層と、

を有し、

前記第1の電極は、前記第1の基板の表面の一部を露出して配置されており、

前記第1の基板において、前記第1の電極から露出している部分の表面にも、凸凹構造が設けられている、

光学素子。

【請求項2】

前記第1の基板と前記第1の電極との接触界面は、相対的に平坦である請求項1記載の光学素子。

【請求項3】

前記第1の基板と前記第1の電極との接触界面も、凸凹である請求項1記載の光学素子。

【請求項4】

前記第1の電極の凸凹構造の算術平均粗さは、20nm～30nmである、請求項1～3いずれか1項記載の光学素子。

【請求項5】

第1の基板に、表面が平坦な第1の電極を形成する工程と、

前記第1の基板の前記第1の電極側から、プラスト法またはエッティング法により、凸凹構造を形成する工程と、

第2の基板に、第2の電極を形成する工程と、
銀を含むエレクトロデポジション材料を含有する電解質層を挟んで、前記第1の基板と
前記第2の基板とを、前記第1の電極と前記第2の電極が対向するように重ね合せる工程
と、
を有する光学素子の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の主な観点によれば、対向配置される第1および第2の基板と、前記第1の基板
の、前記第2の基板との対向面に配置される第1の電極であって、表面に一体的に形成さ
れた凸凹構造を含む第1の電極と、前記第2の基板の、前記第1の基板との対向面に配置
される第2の電極と、前記第1および第2の基板の間隙に、銀を含むエレクトロデポジシ
ョン材料を含有する電解質層と、を有し、前記第1の電極は、前記第1の基板の表面の一
部を露出して配置されており、前記第1の基板において、前記第1の電極から露出してい
る部分の表面は、相対的に凸凹である、光学素子、が提供される。